

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 1 区分

【発行日】平成21年7月23日(2009.7.23)

【公表番号】特表2008-546621(P2008-546621A)

【公表日】平成20年12月25日(2008.12.25)

【年通号数】公開・登録公報2008-051

【出願番号】特願2008-517029(P2008-517029)

【国際特許分類】

C 0 1 B 3/06 (2006.01)

【F I】

C 0 1 B 3/06

【手続補正書】

【提出日】平成21年6月3日(2009.6.3)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

金属水素化物と、

p H が約 1 . 5 未満の液体反応物とを有し、

上記金属水素化物および上記液体反応物の反応が水素を放出することを特徴とする組成物。

【請求項 2】

上記金属水素化物は固体形態の水素化ホウ素ナトリウムである請求項 1 記載の組成物。

【請求項 3】

上記液体反応物の p H は約 1 . 0 未満である請求項 1 記載の組成物。

【請求項 4】

上記液体反応物の p H は約 0 . 1 5 である請求項 3 記載の組成物。

【請求項 5】

上記液体反応物は水、触媒、および酸を有する請求項 1 記載の組成物。

【請求項 6】

上記触媒は塩化コバルトであり、上記酸は硫酸である請求項 5 記載の組成物。

【請求項 7】

上記液体反応物はさらに凍結防止剤を有する請求項 5 記載の組成物。

【請求項 8】

上記金属水素化物の上記液体反応物に対する重量比は約 1 : 1 0 . 0 より小さい請求項 1 記載の組成物。

【請求項 9】

上記金属水素化物の上記液体反応物に対する重量比は約 1 : 8 . 0 より小さい請求項 8 記載の組成物。

【請求項 10】

上記金属水素化物の上記液体反応物に対する重量比は約 1 : 5 . 0 より小さい請求項 8 記載の組成物。

【請求項 11】

金属水素化物と、

液体反応物とを有し、

上記金属水素化物および上記液体反応物の反応が水素ガスを放出し、かつ、上記金属水素化物の上記液体反応物に対する重量比は約 1 : 10 . 0 より小さいことを特徴とするガス発生装置。

【請求項 1 2】

上記金属水素化物の上記液体反応物に対する重量比は約 1 : 8 . 0 より小さい請求項 1 記載のガス発生装置。

【請求項 1 3】

上記金属水素化物の上記液体反応物に対する重量比は約 1 : 5 . 0 より小さい請求項 1 記載のガス発生装置。

【請求項 1 4】

上記液体反応物の pH は約 1 . 5 未満である請求項 1 記載のガス発生装置。

【請求項 1 5】

上記液体反応物の pH は約 1 . 0 未満である請求項 1 4 記載のガス発生装置。

【請求項 1 6】

上記液体反応物の pH は約 0 . 1 5 である請求項 1 5 記載のガス発生装置。

【請求項 1 7】

上記液体反応物は、水、アルコール、または弱酸を有する請求項 1 1 記載のガス発生装置。

【請求項 1 8】

上記金属水素化物および上記液体反応物は膜により分離される請求項 1 1 記載のガス発生装置。

【請求項 1 9】

複数の燃料カプセルをさらに有し、上記燃料カプセルの各々は、膜で分離された、予め定められた量の金属水素化物、および予め定められた量の液体反応物を有する請求項 1 1 記載のガス発生装置。

【請求項 2 0】

上記膜が、移動するエネルギー貯蔵要素により破られて上記金属水素化物および上記液体反応物が反応して水素ガスを生成できるようになる請求項 1 9 記載のガス発生装置。

【請求項 2 1】

自動遮断機構をさらに有し、上記遮断機構が上記ガス発生装置の内部圧力に応答して、上記内部圧力が予め定められた閾値圧力を超えたときに上記遮断機構が上記エネルギー貯蔵要素の移動を停止させる請求項 2 0 記載のガス発生装置。

【請求項 2 2】

上記遮断機構は支持バネにより支持され、上記支持バネが上記遮断機構に働いて上記内部圧力をバランスさせる請求項 2 1 記載のガス発生装置。

【請求項 2 3】

上記支持バネは上記予め定められた閾値圧力を実現する請求項 2 2 記載のガス発生装置。

【請求項 2 4】

上記移動するエネルギー貯蔵要素はコイルバネを有する請求項 2 0 記載のガス発生装置。

【請求項 2 5】

上記コイルバネは上記膜を破るフックを有する請求項 2 4 記載のガス発生装置。